

NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		文件編號 DOCUMENT NO.	S3-NL05
		總頁數 TOTAL PAGE	共 7 頁
文件名稱 TITLE	表面污染分析儀		

機台名稱： 表面污染分析儀

機台編號： CF-M24

制訂部門： 微影光罩組

制訂日期： 2007/09/20

文件制修訂記錄

NO	發行日期	修訂申請書編號	制修訂內容	修訂頁次	版本
01	2007/10/01	-----	制定初版	-----	01
02	2012/07/01		制訂部門名稱異動	P.0	1.2
03					
04					
05					
06					
07					
08					

核 准	審 查	制 訂

 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 表面污染分析儀	
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION ON	1.2	PAGE 第 1 / 7 頁

一、目的：定義 TOPCON 表面污染分析儀操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：適用於 TOPCON 表面污染分析儀。

三、權責：

- 1.組織權責：工程師負責制定及修改規範。
- 2.執行人員資格：經過 TOPCON表面污染分析儀考核通過之人員。

四、名詞定義：

無

五、相關文件：

TOPCON WM-7 操作手冊。

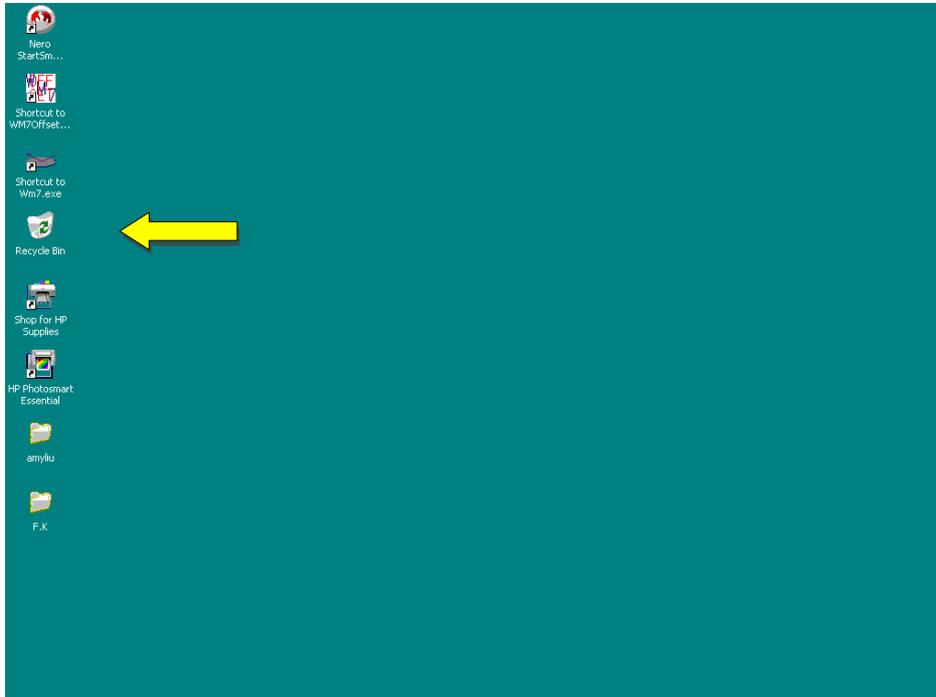
六、標準作業程序：

- 1.確認設備運轉是否正常，若是則設備狀況標示排標示“正常”（綠色牌）。
- 2.檢查使用操作紀錄簿，確認前次使用狀態正常。
- 3.使用 MES 系統開機。
- 4.晶片限用六吋或八吋晶圓。
- 5.欲掃描的試片置放於專用晶舟(一定要用真空吸筆取放晶片，不可用夾子。)，H-Bar 朝下放在 Holder 上。

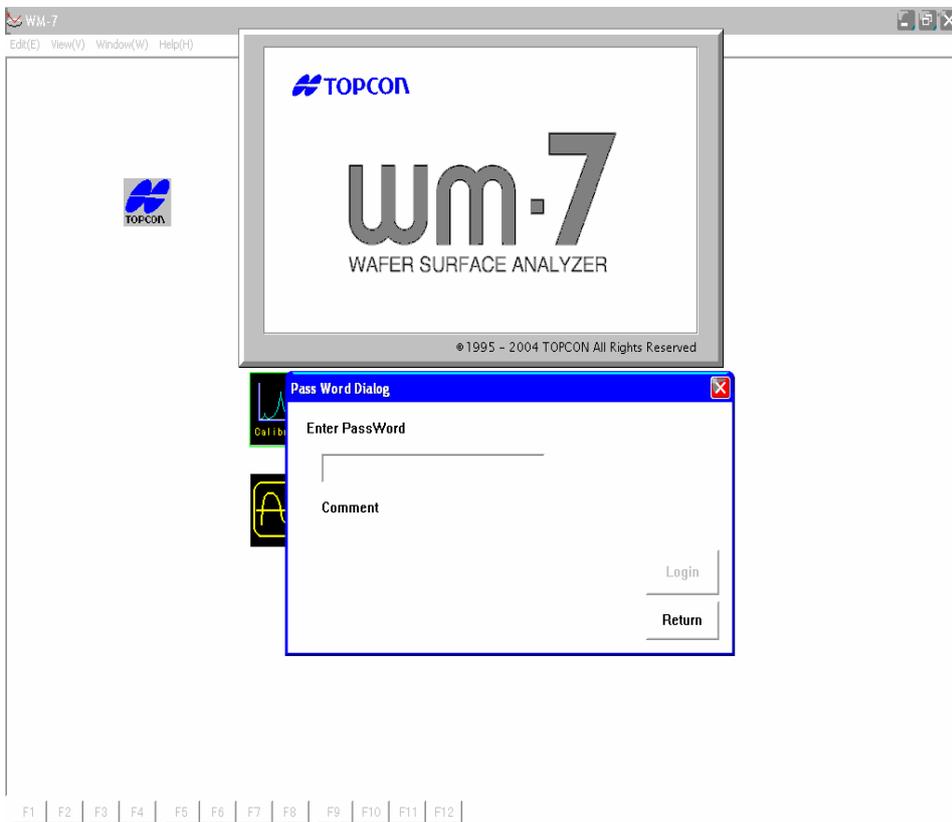


6. 進入 window，選取” shortcut to wm7.exe” 。

		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 表面污染分析儀	
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION ON	1.2	PAGE 第 2 / 7 頁

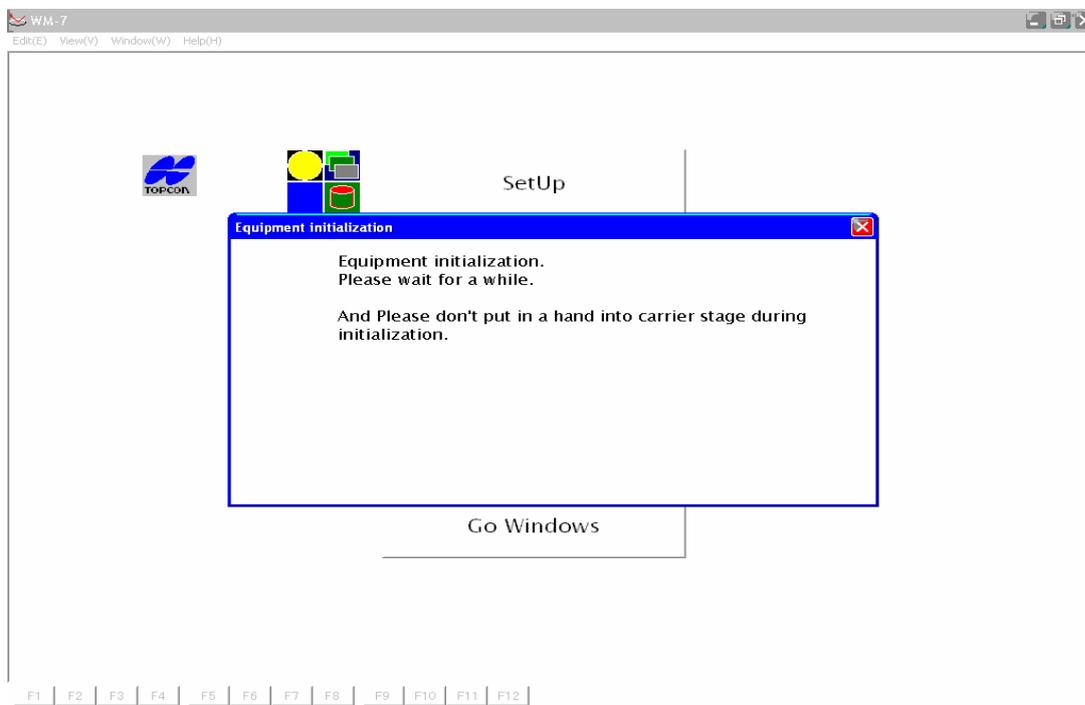


7.進入” shortcut to wm7.exe” 之後，請輸入 password。

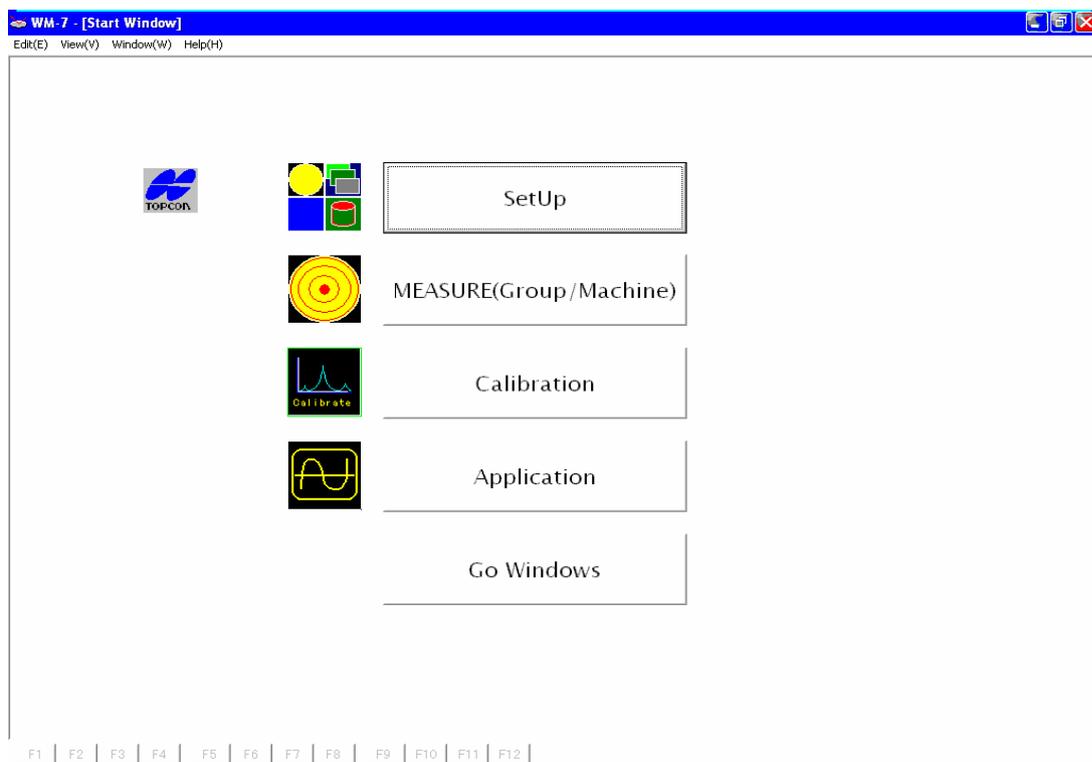


NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 表面污染分析儀	
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION ON	1.2	PAGE 第 3 / 7 頁

8.輸入 password 後，機台會作初使化動作，並於結束後發出警告聲。

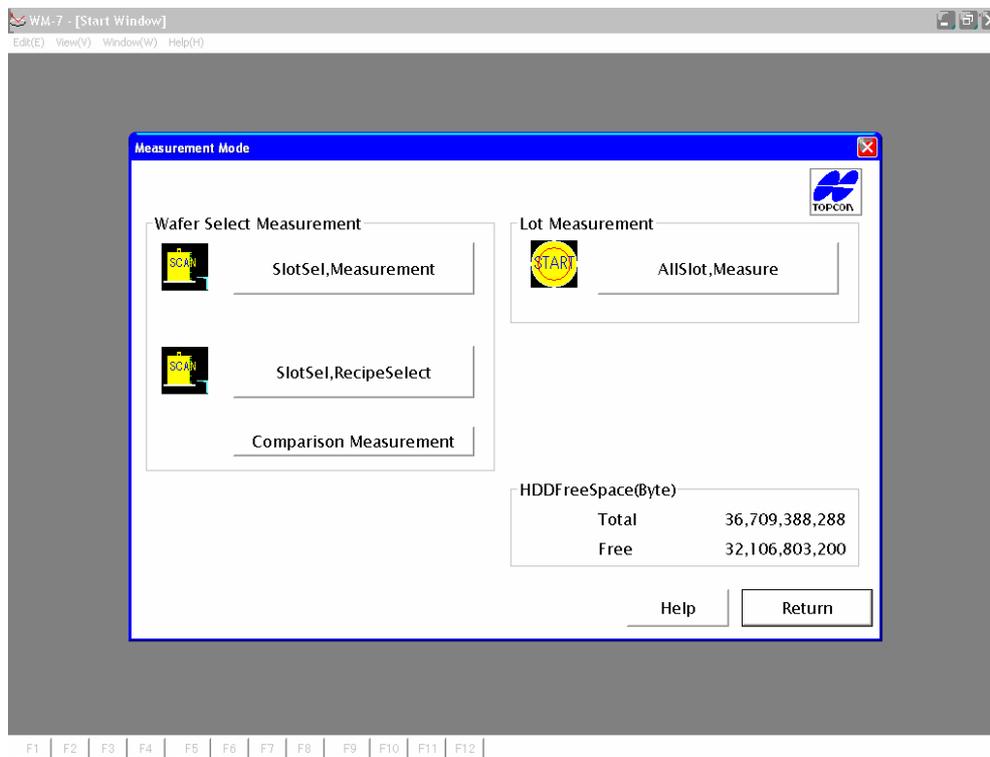


9.選取” MEASURE(Group/Machine)”。

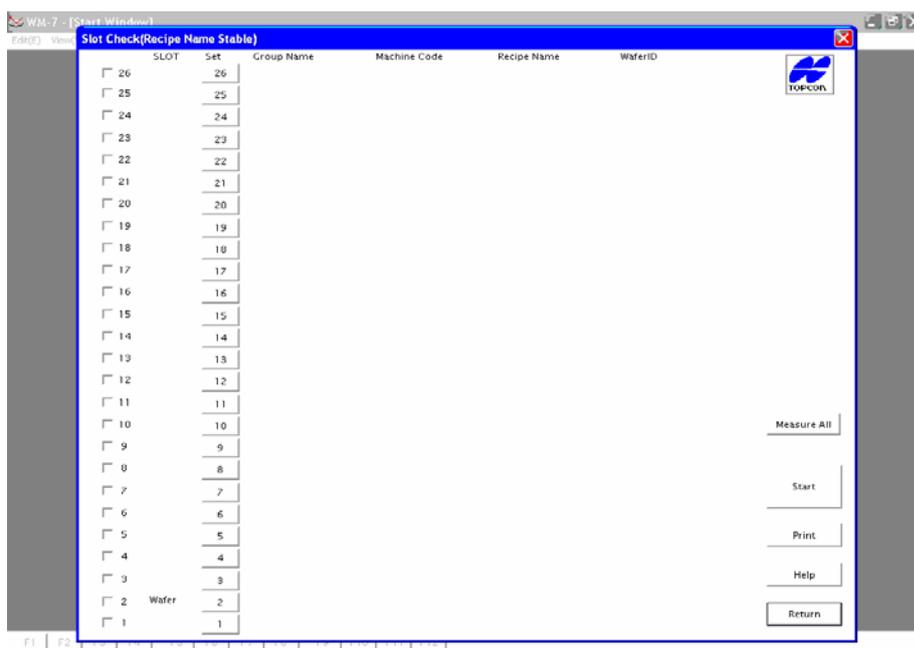


		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 表面污染分析儀	
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION ON	1.2	PAGE 第 4 / 7 頁

10.點選” SlotSel,RecipeSelect” 。

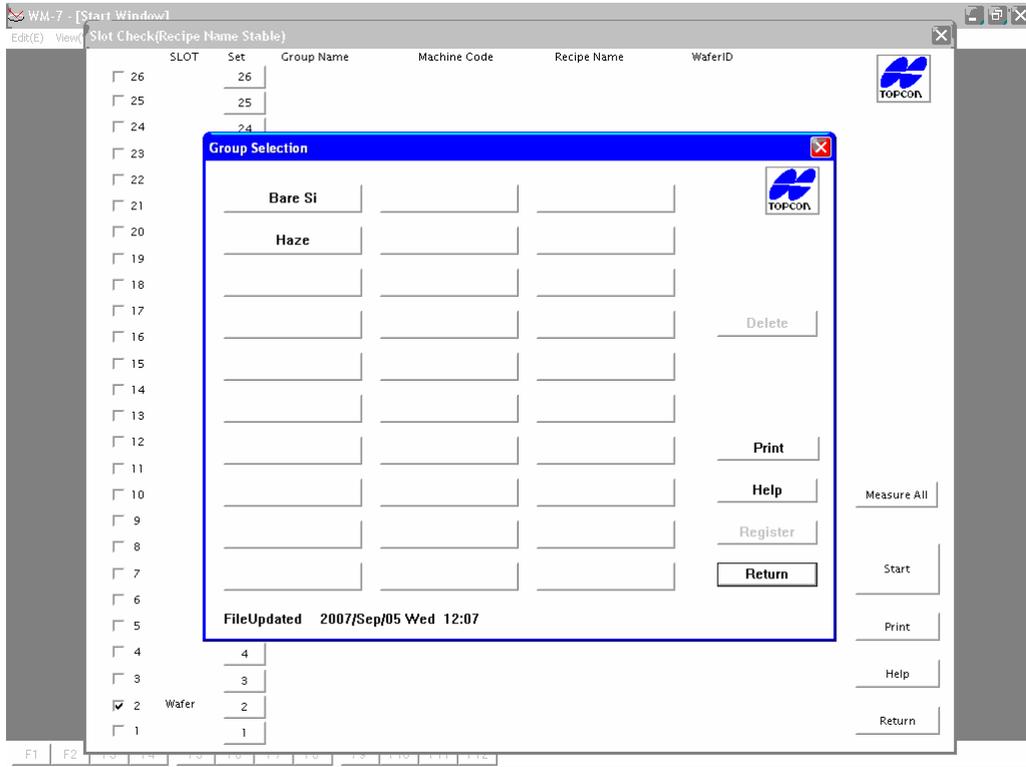


11.出現 wafer mapping 位置表後(如下圖)，點選要測量的 wafer slot number，並且點入 wafer 右側 slot number 小方格以選取程式。

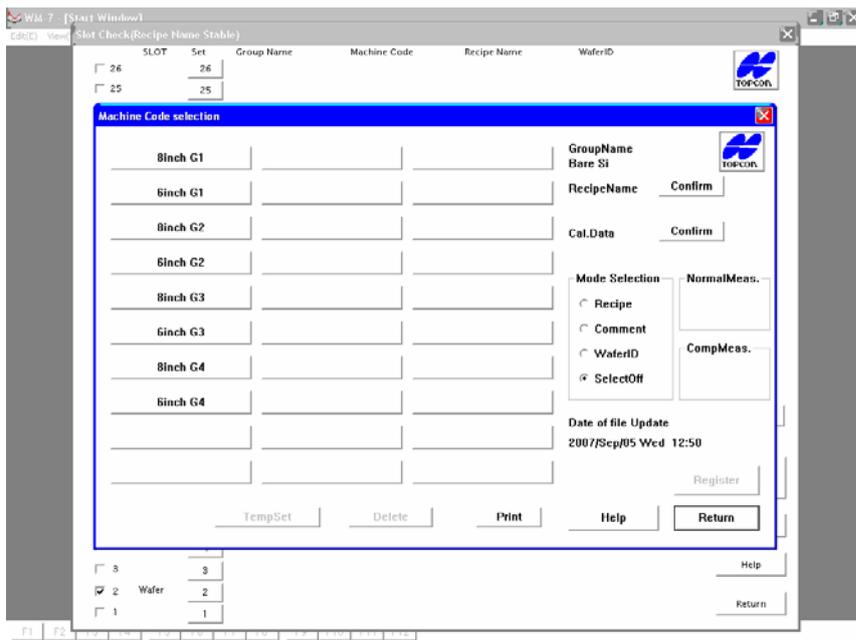


		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 表面污染分析儀	
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION ON	1.2	PAGE 第 5 / 7 頁

12. 選取” Bare Si”

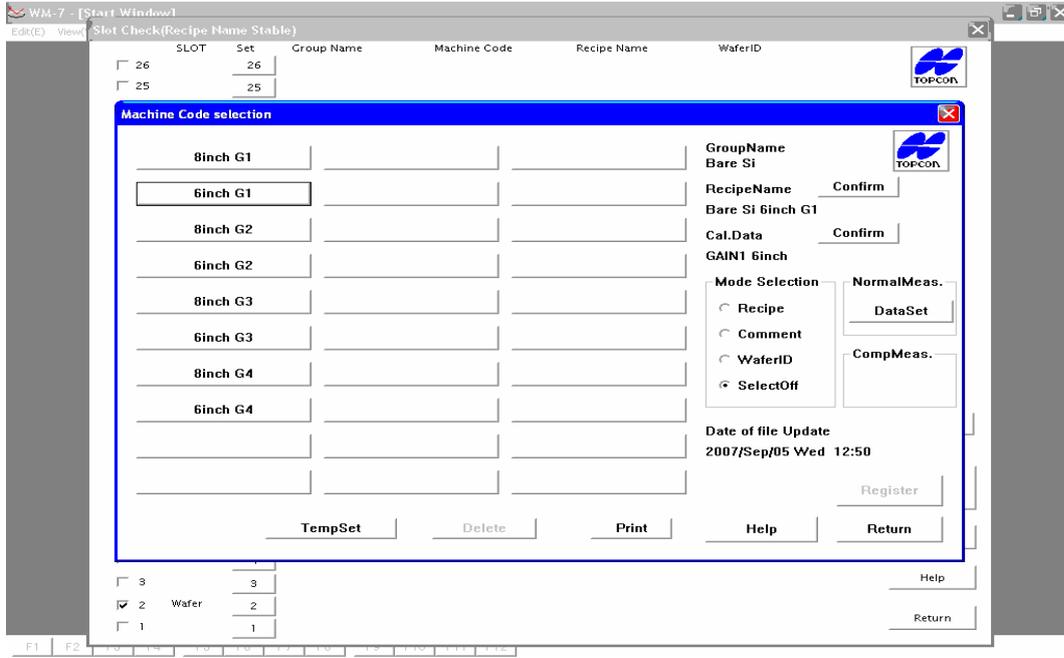


13. 程式選擇方式為：G1 為 scan 粒徑最小的微粒，其次是 G2、G3、G4。



		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 表面污染分析儀	
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION ON	1.2	PAGE 第 6 / 7 頁

14.例如 6 吋WAFER 要SCAN 最小PARTICLE，選取” 6inch G1” 後，在點選” Data Set” 即完成程式選取。



15.此時畫面跳回mapping 畫面(會在選取的晶片後面列出程式,可再確認一次),按下” Start” 便開始掃描動作。

